

488696-2026 - Procedură concurențială

Irlanda – Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots
OJ S 134/2026 15/07/2026

Anunț de participare sau de concesionare - regim standard - Anunț de schimbare
Produse

1. Cumpărător

1.1. Cumpărător

Denumire oficială: Education Procurement Service (EPS)

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Forma juridică a achizitorului: Organism de drept public

Activitatea autorității contractante: Servicii publice generale

2. Procedură

2.1. Procedură

Titlu: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Descriere: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificatorul procedurii: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Tip de procedură: Deschisă

Procedura este accelerată: nu

2.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 38000000 Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)

2.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): South-East (IE052)

Țara: Irlanda

2.1.3. Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Informații generale

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

2.1.5. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Numărul maxim de loturi pentru care un ofertant poate depune oferte: 4

2.1.6. Motive de excludere

Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titlu: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Descriere: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificator intern: 1

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 38000000 Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)

5.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): South-East (IE052)

Țara: Irlanda

5.1.3. Durata estimată

Durată: 48 Luni

5.1.5. Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.7. Achiziție publică strategică

Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.11. Documentele achiziției

Limbile în care documentele achiziției sunt disponibile oficial: engleză

Limbile în care documentele achiziției (sau părți ale acestora) sunt disponibile neoficial: engleză

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: engleză

Catalog electronic: Nu este permisă

Ofertanții pot depune mai multe oferte: Autorizată

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 180 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Locul: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu se știe încă

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: The High Court of Ireland

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: Education Procurement Service (EPS)

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: The High Court of Ireland

Organizația care primește cererile de participare: Education Procurement Service (EPS)

Organizația care prelucrează ofertele: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Lot: LOT-0002

Titlu: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Descriere: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificator intern: 2

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 38000000 Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)

5.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): South-East (IE052)

Țara: Irlanda

5.1.3. Durata estimată

Durată: 48 Luni

5.1.5. Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.7. Achiziție publică strategică

Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.11. Documentele achiziției

Limbile în care documentele achiziției sunt disponibile oficial: engleză

Limbile în care documentele achiziției (sau părți ale acestora) sunt disponibile neoficial: engleză

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: engleză

Catalog electronic: Nu este permisă

Ofertanții pot depune mai multe oferte: Autorizată

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 180 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Locul: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu se știe încă

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: The High Court of Ireland

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: Education Procurement Service (EPS)

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: The High Court of Ireland

Organizația care primește cererile de participare: Education Procurement Service (EPS)

Organizația care prelucrează ofertele: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Lot: LOT-0003

Titlu: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Descriere: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificator intern: 3

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 38000000 Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)

5.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): South-East (IE052)

Țara: Irlanda

5.1.3. Durata estimată

Durată: 48 Luni

5.1.5. Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.7. Achiziție publică strategică

Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.11. Documentele achiziției

Limbile în care documentele achiziției sunt disponibile oficial: engleză

Limbile în care documentele achiziției (sau părți ale acestora) sunt disponibile neoficial: engleză

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: engleză

Catalog electronic: Nu este permisă

Ofertanții pot depune mai multe oferte: Autorizată

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 180 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Locul: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu se știe încă

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: The High Court of Ireland

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: Education Procurement Service (EPS)

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: The High Court of Ireland

Organizația care primește cererile de participare: Education Procurement Service (EPS)

Organizația care prelucrează ofertele: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Lot: LOT-0004

Titlu: Plasma Deposition ,PECVD

Descriere: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identificator intern: 4

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 38000000 Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)

5.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): South-East (IE052)

Țara: Irlanda

5.1.3. Durata estimată

Durată: 48 Luni

5.1.5. Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.7. Achiziție publică strategică

Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.11. Documentele achiziției

Limbile în care documentele achiziției sunt disponibile oficial: engleză

Limbile în care documentele achiziției (sau părți ale acestora) sunt disponibile neoficial: engleză

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: engleză

Catalog electronic: Nu este permisă

Ofertanții pot depune mai multe oferte: Autorizată

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 180 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Locul: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu se știe încă

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: The High Court of Ireland

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: Education Procurement Service (EPS)

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: The High Court of Ireland

Organizația care primește cererile de participare: Education Procurement Service (EPS)

8. Organizații

8.1. ORG-0001

Denumire oficială: Education Procurement Service (EPS)

Număr de înregistrare: IE 6609370 G

Adresă poștală: Castletroy Limerick

Localitate: Limerick

Cod poștal: V94 DK53

Subdiviziunea țării (NUTS): Mid-West (IE051)

Țara: Irlanda

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Telefon: 000

Adresa de internet: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Profilul achizitorului: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției

Organizația care primește cererile de participare

Organizația care prelucrează ofertele

8.1. ORG-0002

Denumire oficială: The High Court of Ireland

Număr de înregistrare: The High Court of Ireland

Departament: The High Court of Ireland

Adresă poștală: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Localitate: Dublin

Cod poștal: D07 WDX8

Subdiviziunea țării (NUTS): Dublin (IE061)

Țara: Irlanda

E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Telefon: +353 1 8886000

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac

8.1. ORG-0003

Denumire oficială: European Dynamics S.A.

Număr de înregistrare: 002024901000

Departament: European Dynamics S.A.

Localitate: Athens

Cod poștal: 15125

Subdiviziunea țării (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Țara: Grecia

E-mail: eproc-esender@eurodyn.com

Telefon: +30 2108094500

Rolurile acestei organizații:

TED eSender

10. Modificare

Versiunea anunțului anterior care urmează să fie modificată

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Principalul motiv al modificării

:

Informații actualizate

Informații privind anunțul

Identificatorul/versiunea anunțului: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Tip de formular: Procedură concurențială

Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesiune - regim standard

Subtipul anunțului: 16

Data notificării expedierii: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: engleză

Numărul de publicare al anunțului: 488696-2026

Numărul ediției JO S: 134/2026

Data publicării: 15/07/2026